

СТРУКТУРНЫЙ ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД В ТВЕРДОМ РАСТВОРЕ $PbTe_{1-x}S_x$

Х.А.Абдуллин, А.И.Лебедев, А.М.Гасъков, В.Н.Демин, В.П.Зломанов

Электрические и фотоэлектрические свойства свидетельствуют о существовании фазового перехода второго рода в $PbTe_{1-x}S_x$. Изменение поведения кривых $\rho(T)$ вблизи T_c при $x \gtrsim 0.2$ связывается с появлением области критического рассеяния.

Структурные фазовые переходы (ФП) в полупроводниках A^4B^6 в настоящее время интенсивно изучаются. Исследуются главным образом твердые растворы с катионным замещением, один или оба компонента в которых являются сегнетоэлектриками^{1,2}. В настоящей работе обнаружен ФП при анионном замещении в твердом растворе $PbTe - PbS$, оба компонента которого изоструктурны и неполярны.

Монокристаллы $PbTe_{1-x}S_x$ ($x = 0,02 - 0,35$) n -типа проводимости ($n = (1,6 - 7) \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$) выращивались методом сублимации. По окончании роста кристаллы закаливались, чтобы избежать распада в твердой фазе³. При $T = 300 \text{ K}$ структура кристаллов – типа $NaCl$.

Электрические свойства образцов изучались по методике⁴. Для всех образцов с $x \gtrsim 0,02$ на температурной зависимости удельного сопротивления $\rho(T)$ обнаруживается резкий пик (рис. 1, *a*), отсутствующий как в $PbTe$, так и в PbS . Положение пика (T_c) закономерно изменяется с x (рис. 2) и не зависит от того, при нагревании или охлаждении записаны кривые $\rho(T)$. Поскольку концентрация носителей в кристаллах не меняется с температурой, появление пика связано с аномальным уменьшением подвижности. Это аномальное рассеяние, по-видимому, вызвано происходящим в кристаллах ФП.

Существование ФП в $PbTe_{1-x}S_x$ подтверждается и другими измерениями. Температурная зависимость ширины запрещенной зоны определялась из спектров фотоэдс p - n -переходов, созданных путем диффузии халькогена в выращенные кристаллы. При $T = T_c$ на зависимости $E_g(T)$ (рис. 3, *a*) наблюдается резкий излом, который характерен для ФП второго рода. На этих же p - n -переходах были проведены измерения температурной зависимости их емкости, квадрат которой (для резких p - n -переходов) пропорционален диэлектрической проницаемости $\epsilon(T)$. В отличие от других соединений A^4B^6 , в которых происходит ФП (например, $Pb_{1-x}Ge_xTe$), не было обнаружено характерной для сегнетоэлектрических ФП ($q = 0$) расходимости $\epsilon(T)$ при T_c (рис. 3, *b*): максимум $\epsilon(T)$ в образцах с $x = 0,04 - 0,1$ лежал в узком интервале $60 - 80 \text{ K}$ и не совпадал с T_c .

Факт появления ФП в $PbTe_{1-x}S_x$ нетривиален. Действительно, оба бинарных соединения – $PbTe$ и PbS – неполярны и имеют кристаллическую решетку одного типа, так что, казалось бы, нет никаких оснований для появления ФП. Однако заметное различие ионных радиусов Te и S может привести к тому, что симметричное положение атома S в узле окажется неустойчивым (аналогично примеси Ge в $PbTe$ ²) и при низкой температуре возникнет упорядочение диполей – случайно расположенных нецентральных атомов серы.

Поведение такой системы можно качественно описать в рамках модели Изинга с туннелированием в приближении случайного молекулярного поля⁵, в которой зависимость T_c от параметров эффективного взаимодействия J и туннелирования Δ имеет вид $\ln(\Delta / 2k_B T_c) = 2\Delta/J$. Предполагая, что величина дипольного момента p пропорциональна разности ионного радиуса атома S и размера полости, в которую он попадает ($p = p_0(1 - x)$, $J \cong A\sqrt{x} \cdot p^2$), а Δ слабо изменяется с x по закону $\Delta = \Delta_0 \exp(cx)$, то подбирая константы c и A , можно достигнуть хорошего согласия расчета с опытом (рис. 2): Значение $c > 0$ означает, что с ростом x из-за сближения минимумов двухъя姆ного потенциала вероятность туннелирования атома серы возрастает.

Из кривых $\rho(T)$ была выделена аномальная часть рассеяния, связанная с появлением ФП. Амплитуда аномального рассеяния практически линейно зависит от концентрации S.

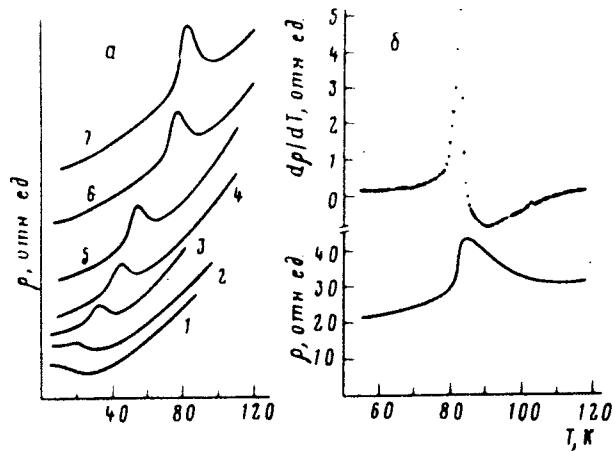


Рис. 1

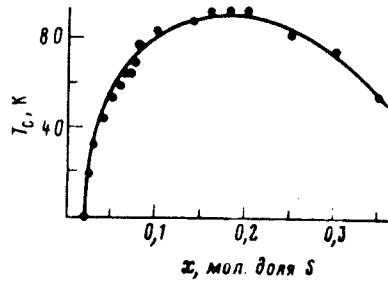


Рис. 2

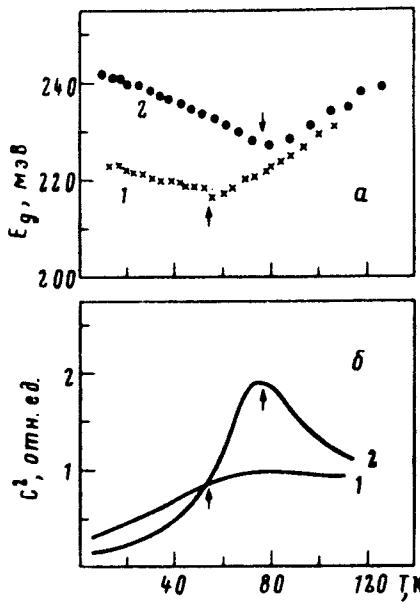


Рис. 3

Рис. 1. *a* – Температурные зависимости удельного сопротивления образцов $\text{PbTe}_{1-x}S_x$: $x: 1 - 0,02; 2 - 0,025; 3 - 0,03; 4 - 0,04; 5 - 0,05; 6 - 0,08; 7 - 0,10$. Кривые произвольно сдвинуты по вертикали. *б* – Температурные зависимости удельного сопротивления и его производной по температуре для образца $\text{PbTe}_{0,75}S_{0,25}$.

Рис. 2. Зависимость температуры фазового перехода от состава твердого раствора $\text{PbTe}_{1-x}S_x$. Сплошная линия – расчет по модели Изинга (см. текст) при значениях параметров $\Delta_0 = 109$ К, $A = 1506$ К, $c = 1,3$

Рис. 3. Температурные зависимости ширины запрещенной зоны (*а*) и квадрата емкости (*б*) в *p-n*-переходах из $\text{PbTe}_{1-x}S_x$ с $x = 0,05$ (1) и $0,08$ (2). Стрелками указаны температура ФП

Температурная зависимость аномальной части изменялась по закону $\Delta\rho \sim (|T - T_c|^{2\gamma} + B)^{-1/2}$, где величина γ лежала в пределах 1,07 – 1,27 и превышала предсказываемое теорией Ландау значение $\gamma = 1$. В образцах с $x \geq 0,1$ отношение скоростей спада кривых $\Delta\rho(T)$ выше и ниже T_c также превышало классическое значение $C_+ / C_- = 2$. При $x \geq 0,25$ величина $C_+ / C_- \approx 5$ соответствует трехмерной модели Изинга, а кривые $\rho(T)$ и $d\rho/dT$ (рис. 1, б) напоминают аналогичные зависимости для критического рассеяния в магнитных материалах⁶. Приведенные данные по-видимому свидетельствуют о появлении в $\text{PbTe}_{1-x}S_x$ достаточно широкой критической области, которую можно ожидать в системах, где отсутствуют дальнодействующие силы. Этот результат, а также нарушение пропорциональности $\Delta\rho(T) \sim \epsilon(T, q \cong k_F)$, равно как и отсутствие резкой аномалии в $\epsilon(T)$ вблизи T_c , указывает на то, что в $\text{PbTe}_{1-x}S_x$ ниже T_c даже при больших x , когда выполняется условие $N_f r_c^3 > 1$ (r_c – радиус корреляции), не появляется макроскопической поляризации ($q = 0$). Возможно, что характер взаимодействия диполей более благоприятствует их антипараллельной ориентации ($J < 0$), а в системе случайно расположенных атомов S возникает фаза дипольного стекла.

Литература

1. Kawamura H. In : Proc. 3 Int. Conf. Phys. of Narrow-Gap Semicond., Warszawa, 1977, 7.
2. Murase K. J. Phys. Soc. Jap., 1980, 49 (Suppl. A), 725.
3. Darrow M., White W., Roy R. Trans. AIME, 1966, 236, 654.
4. Абдуллин Х.А., Лебедев А.И. ФТТ, 1983, 25, 3571.
5. Fischer B., Klein M.W. Phys. Rev. Lett., 1976, 37, 756.
6. Fisher M.E., Langer J.S. Phys. Rev. Lett., 1968, 20, 665.

Московский
государственный университет
им. М.В.Ломоносова

Поступила в редакцию
18 июля 1984 г.